## WHAT IS CLAIMED IS:

- 1. アニオン交換樹脂を触媒としてフェノール類とオキシラン化合物を反応させることを特徴とする芳香族エーテル類の製造方法。
- 2. 上記フェノール類は多価フェノール類であり、且つ合成される芳香族エーテル類はフェノール性水酸基およびアルコール性水酸基を有するものである請求項1に記載の製造方法。
- 3. 溶解度パラメーターが 7.  $0 \sim 20$ . 0 の溶媒の存在下で、フェノール類とオキシラン化合物との反応を行う請求項 1 に記載の製造方法。
- 4. フェノール類がフェノールまたはクレゾールである請求項1に記載の製造方法。
- 5. フェノール類がカテコール類、レゾルシノール類またはハイドロキノン類である請求項1に記載の製造方法。
- 6. フェノール類がカテコール、レゾルシノールまたはハイドロキノンである請求項5に記載の製造方法。
- 7. フェノール類がビスフェノール類である請求項1に記載の製造方法。
- 8. フェノール類がビスフェノールA、ビスフェノールS、ビスフェノールフルオレンまたはビスクレゾールフルオレンである請求項7に記載の製造方法。
- 9. オキシラン化合物がエチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、イソブチレンオキサイドまたは2, 3 ブチレンオキサイドである請求項1に記載の製造方法。
- 10. フェノール類とオキシラン化合物との反応工程で溶媒を使用し、該反応工程後に実施

する晶析工程で使用する溶媒を、該反応工程で使用した溶媒と共通のものとする請求項1に 記載の製造方法。

- 11. 溶解度パラメーターが7. 5~12. 5の溶媒を用いて晶析精製する工程を有することを特徴とする、アルコール性水酸基を有する芳香族エーテル類の製造方法。
- 12. 金属の含有量が100ppm未満(質量基準、以下同じ)であり、且つハロゲン元素の含有量が100ppm未満であることを特徴とする、アルコール性水酸基を有する芳香族エーテル類。